#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-216000

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup> H 0 1 L 21/027	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 3 F 7/20	5 2 1	7316—2H 7352—4M	H 0 1 L 21/30	3 <sup>°</sup> 1 1 L

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)	出願	番	号
------	----	---	---

特願平5-23564

(22)出願日

平成5年(1993)1月19日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 加賀屋 寛人

神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キ

ヤノン株式会社小杉事業所内

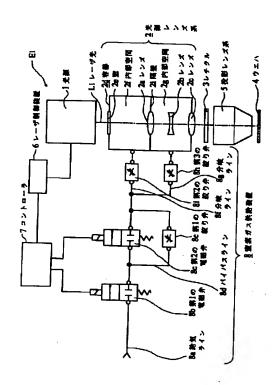
(74)代理人 弁理士 阪本 善朗

## (54)【発明の名称】 露光装置

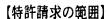
#### (57)【要約】

【目的】 露光装置のレンズ系の容器の空気を迅速に不活性なガスによって置換する。

【構成】 光源1から発せられたレーザ光 $L_1$  は光源レンズ系2、レチクル3および投影レンズ系5を経てウエハ4に照射される。光源レンズ系2のレンズ2 $a\sim2c$  は容器2dに収容されており、光源1の駆動開始と同時に窒素ガス供給装置8の第1および第2の電磁弁8b,8cが開かれて、大流量の窒素ガスが容器2dの内部空間2f,2gへ供給され、空気と置換される。所定の時間を経過したのち、コントローラ7に設定されたプログラムによって第2の電磁弁8cが閉じられる。これ以後はバイパスライン8dのみにより小流量の窒素ガスが容器2dに供給される。







【請求項1】 基板に照射される照明光の光路の光学系を収容する容器と、該容器に不活性なガスを供給する給気ラインと、該給気ラインに設けられた開閉弁および流量切換手段と、前記照明光の光源の駆動開始および停止とそれぞれ同期して前記開閉弁を開閉するとともに、前記開閉弁が開かれた後に所定のプログラムに基づいて前記流量切換手段を駆動する制御手段からなる露光装置。

【請求項2】 流量切換手段が、給気ラインのバイパスラインを除く部分を遮断することの自在な第2の開閉弁 10からなることを特徴とする請求項1記載の露光装置。

【請求項3】 流量切換手段が、給気ラインに設けられた可変弁からなることを特徴とする請求項1記載の露光装置。

【請求項4】 容器の雰囲気ガスの酸素濃度を検出するセンサが設けられ、制御手段が、所定のプログラムの替わりに前記センサの出力に基づいて流量切換手段を駆動するものであることを特徴とする請求項1ないし3いずれか1項記載の露光装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特に、強力な光束をもち雰囲気ガスを活性化しやすい遠紫外線やエキシマレーザ光を照明光とする露光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体の製造等に用いられる露光装置において、特に、強力な光束をもち雰囲気ガスを活性化しやすい遠紫外線やエキシマレーザ光を照明光とするものは、光源のレンズ系や、投影レンズ系等の光学系の雰囲気ガスの酸素や有機物等が照明光によって活性化され、30 これらの化学反応によって前記光学系の光学部材の表面が汚染されるおそれがある。そこで、光源のレンズ系や投影レンズ系等の光学系を容器内に収容し、該容器の空気を窒素ガス等の不活性なガスによって置換することによって各光学部材の汚染を防ぐ方法が開発された。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 の技術によれば、光学系を収容する容器は密閉性の高い ものではないため、露光を開始する毎に不活性なガスを 供給し、容器内の酸素濃度が所定の値に低下するまで露 40



とを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明の露光装置は、基板に照射される照明光の光路の光学系を収容する容器と、該容器に不活性なガスを供給する給気ラインと、該給気ラインに設けられた開閉弁および流量切換手段と、前記照明光の光源の駆動開始および停止とそれぞれ同期して前記開閉弁を開閉するとともに、前記開閉弁が開かれた後に所定のプログラムに基づいて前記流量切換手段を駆動する制御手段からなることを特徴とする。

【0006】流量切換手段が、給気ラインのバイパスラインを除く部分を遮断することの自在な第2の開閉弁からなるとよい。

【0007】また、流量切換手段が、給気ラインに設けられた可変弁から構成されていてもよい。

【0008】さらに、容器の雰囲気ガスの酸素濃度を検出するセンサが設けられ、制御手段が、所定のプログラムの替わりに前記センサの出力に基づいて流量切換手段 を駆動するものであってもよい。

[0009]

【作用】光源の駆動開始と同期して開閉弁を開いて不活性なガスの供給を開始する。光源の駆動開始後、所定時間を経過したのち、所定のプログラムに基づいて流量切換手段が駆動され、容器に供給される不活性なガスの流量が低減される。あるいは、光源の駆動開始後、センサによって容器内の酸素濃度をモニタし、酸素濃度が配動されるよって容器内の酸素濃度をモニタし、酸素濃度が駆動されるように構成してもよい。光源の駆動開始と同時に大流量の不活性なガスを容器に供給し、容器の雰囲気ガスを迅速に置換させたのち、不活性なガスの供給量を定常値へ低減することで不活性なガスの消費量を低減することができる。

[0010]

【実施例】本発明の実施例を図面に基づいて説明する。 【0011】図1は、第1実施例を説明する説明図であって、本実施例の露光装置 $E_1$ は、一般にステッパと呼ばれる縮小投影型の半導体露光装置であって、エキシマレーザからなる光源1と、光源1から発せられた照明光であるレーザ光 $L_1$ を所定の形状の光束に成形する光学

2つの内部空間 2 f , 2 g に分割するための隔壁 2 i を有する。なお、図示最下端のレンズ 2 c は、レチクル 3 に向ってレーザ光  $L_1$  を放出する第 2 の窓を兼ねている。

【0013】容器2dの各内部空間2f,2gにそれぞれ不活性なガスである窒素ガスを供給する窒素ガス供給装置8は、図示しない窒素ガス供給源に接続された給気ライン8aと、該給気ライン8aに設けられた開閉弁である第1の電磁弁8bと、その下流側に接続された第2の開閉弁である第2の電磁弁8cと、これを迂回するパ10イパスライン8dと、該パイパスライン8dに設けられた第1の絞り弁8eと、バイパスライン8dの下流側に設けられた一対の分岐ライン8f,8gと、分岐ライン8f,8gにそれぞれ設けられた第2および第3の絞り弁8i,8hからなり、第2および第3の絞り弁8i,8hからなり、第2および第3の絞り弁8i,8hの吐出側はそれぞれ容器2dの内部空間2f,2gに接続されている。

【0014】第1の電磁弁8bは、レーザ制御装置6の 出力によって光源1が駆動あるいは停止されると同時 に、コントローラ7の出力信号によって開閉されるもの 20 であり、第2の電磁弁8cは、光源1が駆動されると同 時に第1の電磁弁8bとともに開かれて、所定の流量の 窒素ガスを分岐ライン8f,8gに供給し、コントロー ラ7に設定されたプログラムである窒素供給プログラム によって所定時間を経たのちに閉じられる。また、容器 2 d の各内部空間 2 f, 2 g の酸素濃度を検出するセン サを設け、該センサの出力に基づいて第2の電磁弁8c を閉じるように構成してもよい。第1の絞り弁8 e は、 第1の電磁弁8 bが開かれた後、常時バイパスライン8 dを経て所定の流量の窒素ガスを容器2dの内部空間2 30 f, 2gに供給する。第2,第3の絞り弁8i,8h は、それぞれ分岐ライン8f,8gから容器2dの内部 空間2f,2gに供給される窒素ガスの流量の比率を調 節するものである。

【0015】第2の電磁弁8cを閉じるタイミングは、 光源1の駆動後に所定の強度の照明光が得られるまでの 光源1の立上り時間に基づいて設定されるもので、図2のタイムチャートA〜Eに示すような窒素供給プログラムによって制御される。また、露光装置 $E_1$ において露 光が終了し、光源1の駆動が停止されると同時に、第140の電磁弁8bが閉じられて、窒素ガスの供給が停止される。

【0016】図2のタイムチャートAに示す窒素供給プログラムは、光源1の駆動開始時刻 $t_0$ において第1および第2の電磁弁8b,8cを開き、大流量値 $q_1$ で示す供給量の窒素ガスを容器2dの各内部空間2f,2gに供給し、各内部空間2f,2gの雰囲気の酸素濃度を速かに低下させたのち、時刻 $t_1$ において第2の電磁弁8cを閉じる。光源1がエキシマレーザである場合は、光源1を駆動したのちに所定の出力のレーザ光が得られ50

るまでに数分以上の時間を必要とする。前述の時刻  $t_1$  は、このような光源1の立上り時間に合わせて設定される。時刻  $t_1$  において第2の電磁弁8 c が閉じられると、窒素ガスはパイパスライン8 d のみを経て容器 2 d の各内部空間 2 f , 2 g に供給されるため、窒素ガスの供給量は小流量値(定常値)  $q_2$  に低下する。時刻  $t_2$  において露光装置の露光が終了し、光源1の駆動が停止されると、これと同時に第1の電磁弁8 b が閉じられて窒素ガスの供給が停止される。なお、小流量値  $q_2$  は、容器 2 から漏出する窒素ガスを補うのに充分であればよい。

【0017】タイムチャートBは、前述のセンサによっ て検出された酸素濃度が所定の値に減少した時刻 t3 に おいて第2の電磁弁8cを閉じるように設定した窒素供 給プログラムを示し、タイムチャートCは、上記酸素濃 度が所定の値に減少した時刻  ${f t}$   ${f 3}$  から所定の時間遅れ ${f \Delta}$ t を経た時刻 t 4 において第2の電磁弁8cを閉じるよ うに設定した窒素供給プログラムを示し、タイムチャー トDは、前述のタイムチャートA~Cの時刻 $t_1$ ,  $t_3$ または  $t_4$  において第2の電磁弁 8 c を閉じたのち、こ れを間欠的に開くことによって容器2dから漏出する窒 素ガスを補充する窒素供給プログラムを示すもので、こ の場合はバイパスライン8dを必要としない。また、タ イムチャートEは、前述のセンサによって検出された酸 素濃度が所定の値 $\,{
m d}_{\,1}\,$ に減少した時刻 $\,{
m t}_{\,3}\,$  において第 $\,2\,$ の電磁弁 8c を閉じたのちも時刻  $t_5$  まで前記センサに よる測定を継続し、これによって容器2dの酸素濃度を 所定の値に維持するのに必要な窒素ガスの供給量を実測 し、これに基づいて窒素ガスの補充量を設定する窒素供 給プログラムを示すものである。

【0018】本実施例によれば、光源の駆動開始とともに大流量の窒素ガスを光源レンズ系の容器内へ供給し、容器内の空気を短時間で窒素ガスによって置換させるとともに、所定時間後あるいは容器内の酸素濃度が所定の値に低減したのちに窒素ガスの供給量を縮小することで、大量の窒素ガスを消費することなく容器の空気を迅速に窒素ガスと置換させることができる。

【0019】図3は、第2実施例を説明する説明図であって、本実施例の露光装置 $E_2$ は、第1実施例と同様に、エキシマレーザからなる光源21と、光源21から発せられた照明光であるレーザ光 $L_2$ を所定の光束に成形する光学系である光源レンズ系22と、該光源レンズ系22によって所定の光束に成形されたレーザ光 $L_2$ をレチクル23を経てウエハ24に結像させる投影レンズ系25からなる。光源21はそのレーザ出力を制御するレーザ制御装置26を有し、レーザ制御装置26は制御手段であるコントローラ27によって制御される。

【0020】光源レンズ系22は、レーザ光 $L_2$ を所定の光束に成形するためのレンズ22a, 22bを有し、これらは容器22dに収容され、容器22dは、光源2

1 に対向する端壁に窓 2 2 e を有し、また、図示下方のレンズ 2 2 b はレチクル 2 3 に向ってレーザ光  $L_2$  を放出する第 2 の窓を兼ねている。

【0021】容器22dの内部空間22fに不活性なガ スである窒素ガスを供給する窒素ガス供給装置28は、 図示しない窒素ガス供給源から容器22dの内部空間2 2 f に窒素ガスを供給する給気ライン28 a と、該給気 ライン28aに直列に設けられた開閉弁である第1の電 磁弁28bおよび可変弁28cと、容器22dの内部空 間22fから雰囲気ガスを排出する排気ライン28h と、これに設けられた第2の電磁弁28gと、容器22 dの内部空間22fの酸素濃度を検出するセンサ28f からなり、第1の電磁弁28bおよび可変弁28cは光 源21の駆動開始と同時に開かれて容器22dの内部空 間22fに所定の大流量値の窒素ガスを供給し、センサ 28 fによって検出される酸素濃度が所定の値に減少し たとき、可変弁28cが切換えられて、窒素ガスの供給 量を所定の小流量値(定常値)に減少させるように構成 されている。なお、光源21の駆動開始と同時に、第2 の電磁弁28gを開き、排気ライン28hから容器22 20 dの内部空間22fの空気を排出すれば、窒素ガスによ る置換をより一層迅速に行うことができる。

【0022】本実施例は、バイパスラインを必要とせず、また、容器22dの密封状態に応じて可変弁28cを数段階に切換えることによって補充用の窒素ガスの流量を変化させることができる。

[0023]

【発明の効果】本発明は上述のとおり構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

【0024】大量の不活性なガスを消費することなく、30

光学系の容器の空気を不活性なガスによって迅速に置換することができる、その結果、露光装置の待機時間を短縮し、スループットを改善できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例を説明する説明図である。

【図2】図1の装置を制御するタイムチャートの様々な例を示す図である。

【図3】第2実施例を説明する説明図である。 【符号の説明】

10 L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub> レーザ光

1,21 光源

2,22 光源レンズ系

2d, 22d 容器

3,23 レチクル

4,24 ウエハ

5,25 投影レンズ系

6,26 レーザ制御装置

7,27 コントローラ

8,28 窒素ガス供給装置

8 a, 2 8 a 給気ライン

8b, 28b 第1の電磁弁

8c, 28g 第2の電磁弁

8 d バイパスライン

8e 第1の絞り弁

8 i 第2の絞り弁

8h 第3の絞り弁

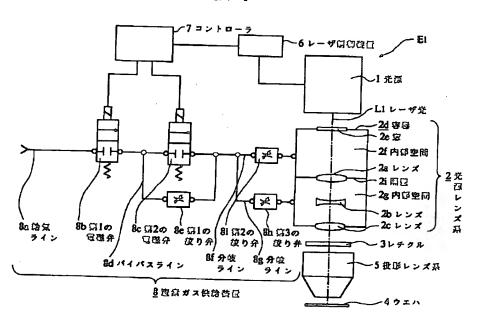
28c 可変弁

28f センサ

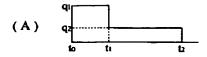
201 209

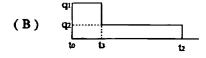
28h 排気ライン

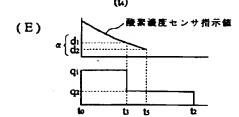
#### 【図1】



【図2】







to: N2供給開始

tu: N2供給量切り換え

tz: N2供給停止

ts: N2酸素装度が規定値以下になった時間

qı:大流量包

Q2:小桃重饭

d: 酸紫濃度規定值

Δ:酸素濃度規定值 - α

【図3】

